

Лазерный генератор изображений 4PICO PicoMaster 200



Производитель:
4PICO

Характеристики

Описание

Лазерные генераторы изображений 4PICO представляют собой универсальные лазерные генераторы изображений с ультравысокой точностью, специально разработанные для предоставления пользователю максимальной свободы создания микроструктур в фоточувствительных слоях. Принцип растривания генератора обеспечивает равномерное экспонирование по всей поверхности. Сканирование подложки с высокой скоростью и шаговый привод экспонирующего модуля с программной регулировкой высоты делает

MicroMaster 200 идеальным фотолитографическим инструментом для исследований, разработок, а также для опытного и мелкосерийного производства.

Ключевые особенности лазерных генераторов 4PICO серии PicoMaster:

- 4 режима экспонирования - 0,3 мкм, 0,6 мкм, 0,9 мкм, 5 мкм;
- Переключение режимов экспонирования в ПО установки, без смены объективов;
- Экспонирование одной топологии разными режимами в одном рецепте для увеличения производительности;
- Уникальная запатентованная конструкция экспонирующего модуля, позволяющая автофокусу моментально обрабатывать все неровности подложки;
- Экспонирование многослойных структур с совмещением по меткам;
- Полутоновое экспонирование;
- Возможность замены экспонирующего модуля на новый путем откручивания 4 винтов, без дополнительных настроек и калибровок (минимальное время простоя);
- Понятное и функционально насыщенное ПО, позволяющее при необходимости настроить процесс на самых глубоких уровнях.

Зависимость скорости экспонирования от минимального размера пятна

Разрешение	Скорость экспонирования при 50% наложении (normal quality)	Скорость экспонирования при 30% наложении (reduced quality)
0,3 мкм	1,7 мм ² /мин	2,6 мм ² /мин
0,6 мкм	3,4 мм ² /мин	5,3 мм ² /мин
0,9 мкм	5,2 мм ² /мин	7,7 мм ² /мин
5 мкм (опция)	29 мм ² /мин	43 мм ² /мин

Доступные опции:

- Замена источника излучения 405нм на источник с длиной волны 375нм;
- Модуль поддержания температуры и влажности в рабочем объеме генератора;
- Запасной экспонирующий модуль (375 нм или 405 нм на выбор).